

Установка плазмохимического травления Takachi ICP

**Производитель:**

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Takachi ICP компании Plasma-Therm — это современная, универсальная, надежная система плазмохимического травления в индуктивно-связанной плазме, которая идеально подходит для решения широкого спектра технологических задач в области микроэлектроники. Takachi ICP — последняя разработка компании Plasma-Therm, в которой применены промышленные технологии оборудования компании Plasma-Therm. Высокая производительность и низкая стоимость обслуживания установки Takachi ICP позволяют использовать ее как для R&D-лабораторий, так и для пилотного производства.

Установка Takachi ICP в базовой комплектации оснащена автоматическим

вакуумным шлюзом, что позволяет эффективно проводить процесс травления практически всех типов материалов, которые используются на микроэлектронных производствах:

- GaN, GaAs, AlGaP, InP, InGaAs, HgCdTe.
- SiC, Al₂O₃, DLC.
- Si, SiO₂, SiN_x.
- Cr, Ti, Al, TiN, TiW, Mo.
- Резисты, полиимиды.

Ключевые преимущества установки Takachi ICP:

- Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм (поштучная обработка, наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации).
- Равномерность травления по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше $\pm 3\%$.
- Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой загрузки.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
- Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь <1 м².
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
- Возможность изготовления опций и оснастки «под заказ».

Основные опции

- Система отслеживания окончания процесса:
 - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
 - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
 - Лазерная интерферометрия (LEPD)

- Дополнительные газовые линии (до 20 в сумме),
- Расширение температурного интервала электрода (например, -25...+60 С, либо диапазон на заказ),
- Специальные держатели образцов,
- Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта,
- Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM,
- Пакет для установки через стенку ЧПП,
- Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки,
- Расширенная гарантия производителя,
- Специальные опции под заказ